文章编号: 1001 3806(2004) 06 0604 05

光波导放大器的研究进展

苏洁梅,戴基智,杨亚培 (电子科技大学光电信息学院,成都 610054)

摘要: 总结了光波导放大器近年来的研究新进展,介绍了在材料、制作工艺和波导结构方面取得的成果,分析 了今后光波导放大器的研究方向。

关键词: 集成光学;光波导放大器;制作工艺;波导结构 中图分类号: TN722 文献标识码: A

Review of the new development of optical waveguide amplifier

SU Jie-mei, DAI Ji-zhi, YANG Ya-pei

(School of Optoelectionic Information, University of Electionic Science and Technology of Optima, Chengdu 610054, China)

Abstract: The new developments of optical waveguide amplifier are summarized. Anothers with different structures, different fabricating methods and different material are described.

Key words: integrated optics; optical waveguide amplifier; fabricating method; waveguide structure

引 言

光波导放大器是90年代初出现的又一种新型. 光放大器,与光纤放大器相比,光波导放大器具有以下优点:制造成本低、单位长度增益高、结构紧凑、易于与其它光学器件集成、可以在同一衬底上提供无源和有源光路。基于以上优点,掺铒光波导放大器(EDWA)可望在光通信和集成光学领域得到广泛应用。2001年开始出现了商用化掺铒波导光放大器。

近年来, 全光通信网络的飞速发展和超长距离的传输, 对光波导放大器提出了更高的要求。目前的波导放大器研制正朝着更高的增益、更宽的带宽、 更高的传输功率和更高的集成度等目标迈进。下面 对光波导放大器的发展状况做一个比较系统的介 绍。包括光波导放大器材料研制, 器件制作以及器 件结构、应用。

1 光波导放大器用放大材料的研究状况

光波导放大器的激光介质是有源波导,是在普通光波导中掺入稀土元素,使原来无活性的波导变为有活性的波导,即有源波导。稀土元素即元素周

作者简介: 苏洁梅(1978), 女, 硕士, 从事光放大器和电磁计算方面的研究工作。

E-mail: sujiemei@ sina. com

收稿日期: 2003 10 20; 收到修改稿日期: 2004 04 07

期表中的镧系元素,由于独特的原子结构,使得它们 具有独特的光谱特性。掺稀土元素的激光材料跃 迁,产生非常尖锐的激光线型,适合做为光放大器的 材料。铒离子、钕离子和镨离子的一些能级跃迁所 发出的光子频率刚好和光通信使用的光频率相同, 因此得到了广泛应用。

1.1 掺铒材料

图 1 为 Er³⁺ 的能级图。由图可见, 电子跃迁发 出的 1540nm 波长, 处于光通信的 1550nm 低损耗窗 口; 而 800nm, 980nm 和 1480nm 波长刚好又与半导体 抽运激光管的发光波长区吻合。这样, 只要有中等 大小的抽运功率就可获得高浓度的粒子数反转。



图 1 Er³⁺ 能级结构和跃迁情况

由于铒离子的能级特点,使得掺铒材料得到了 广泛研究,并应用于实际器件制造中。表1中给出 近年来掺铒材料的研究进展。

表 1	不同	甚	质材料	的	É	位	增	걾
7. 1		200	19. IN 19. I		_	<u> </u>		

** *1	制作工艺	Er ³⁺ 质量分数	增益	
ሰባ ቶት	巾ITF⊥乙	1 %	/ (dB• cm ^{- 1})	
phosphosili cate	PECVD	0.48	0.67	
P20 \$iO 2	FHD	0.77	0.68	
Al_2O_3	ion - implant	1.5×10^{26}	0.75	
		/ ($\mathrm{ions}^\bullet\mathrm{m}^{-3})$		
Y_2O_3	sputt ering	0.34	1.3	
$Al_2OP_2O_5$	so l gel	1.17	1.35	
SiO_2				
silicate	io n exchange	0.25	2.3	
phosphate	io n exchange	2	3.3	
phosphate	sputt ering	1.65	4.1	
soda lime	sputt ering	2.0×10^{26}	4.2	
		/ (ions• m ^{- 3})		

试验证明, 当掺杂玻璃中的 Er³⁺ 质量分数增大 时, 会引起铒离子之间的交叉弛豫, 使铒离子亚稳态 的寿命缩短。这种效应使掺杂质量分数的提高受到 了限制。解决这种限制的方法是在掺铒玻璃中掺入 一些 Al₂O₃ 或者 Yb³⁺ 离子, 使得 Er³⁺ 的分布均匀。 同时, Yb 离子在 980nm 波长附近有很强的吸收截 面, 可以作为抽运吸收敏化剂, 负责将吸收的抽运光 能量转移给 Er 离子, 提高抽运效率。波导的基片常 用硅酸盐玻璃或磷酸盐玻璃。它们能够接受非常高 的 Er³⁺Yb³⁺ 掺杂离子数浓度(超过 10²⁶ions/m³, 比硅 玻璃高 100 倍)。同时制作出的波导损耗相对较小。 有报道称, 氟铝酸盐玻璃具有更大的荧光强度和较 小的浓度猝灭效应^[1], 但是尚未见氟铝酸盐玻璃制 作光波导放大器的文章。

1.2 掺钕与掺镨材料

掺铒玻璃只能在 1550m 波段提供光放大。 1300m 波长是目前大量铺设的光纤系统的通信窗 口,故研究和发展 1300m 波段的放大器材料,对提 高现有光纤通信系统的能力具有非常重要的意义。

人们很早就发现, 掺钕材料在 1300nm 波段显示 出受激放大的能力。但因为在 1050nm 波长处具有 很强的自发辐射, 在 1300nm 波长附近具有很强的激 发态吸收, 因而掺钕材料的作为放大介质受到到了 限制。近年来研究发现, 一种新的掺镨材料也具有 受激放大 1300nm 波长光信号的能力, 并具有宽带, 高增益放大特性, 因此更具有吸引力。Nd³⁺ 和 Pr³⁺ 的能级结构和跃迁情况如图 2 所示。

掺镨材料做成波导放大器的主要困难在于放大



图 2 Nd³⁺ 和 Pr³⁺ 的能级结构和跃迁情况

效率低, 需要很好的抽运功率。在掺镨的 SiO2 玻璃 中, 能级差较小而其非辐射性衰落速率较高, 使得在 1300nm 波长处放大效率 较低。因此, 为了实现 1300nm 波长的光放大, 应寻求新的玻璃基质。InF4 氟 化物玻璃、混合卤化物玻璃、硫化物玻璃都是非常好 的选择。但这些基质材料的特性尚需要进一步研究。 目前掺钕光波导放大器对 1054nm 的信号光进行放 大, 其抽运功率为 346nW, 抽运波长 514nm, 可得到 1. 5dB/ cm 的增益^[2]。而掺镨光波导器对1.064m信号光 进行放大, 可得到 8. 6dB 的增益(Pr 掺杂离子数浓度 为1.06×10²⁶ions/m³, 波导长度 2. 2cm)^[3]。

光波导制作工艺

2

光波导放大器的制作涉及到化学工艺、真空工 艺、半导体工艺等。最关键的是具有特定参数的光 波导的形成。光波导的制作方法主要有火焰水解法 (FDH)、离子注入法(iorrimplanted)、RF 溅射/化学气 相沉淀法(CVD)、离子交换法(iorrexchanged)、溶胶 凝胶法(solgle)和复合波导技术。目前常用方法是 离子交换法,相对其它方法而言,离子交换法工艺简 单、成本低,应用最多也最成熟。而近年来,热压粘 结法和溶胶凝胶法由于各自的优点,也受到人们的 关注。

2.1 离子交换法

用离子交换法在氧化物玻璃基片上制作出的波 导掩埋于玻璃表面下,这样可以保证波导稳定并使 其性能得到优化,这种波导具有更低的传输损耗和 偏振相关性,可以支持限定的模式,且能够很好地与 光纤兼容。

在离子交换法中存在几个问题。一个是光刻制 备掩模过程对玻璃表面的破坏,尤其是去掉铝膜所 用的腐蚀液,会严重破坏玻璃表面,使制备的条形波 导具有很大的传输损耗。选择适当的金属掩模以及 对玻璃无损的腐蚀液,可得到光学性质更好的条形

波导。目前工作还在进行中。其次是离子交换一般 采用 K^+ - Na^+ 离子交换, 由于两种离子半径差别很 大,使玻璃交换层产生较大的应力,因而造成样品表 面损坏,给波导带来较大的传输损耗,一般远大干 1dB/cm。故有人提出使用 Ag⁺-Na⁺ 离子、Ag⁺-Li⁺ 离子交换。目前, 铒镱共掺磷酸盐玻璃采用 Ag⁺-Li⁺ 离子交换法可得到增益为 3.3dB/cm 的波导放 大器。另外一个问题是只进行离子交换形成的光波 导的截面是半椭圆形的,它的折射率极大值在表面 处,为非对称分布。这种波导稳定性较差,日在与折 射率对称分布的光纤进行对接耦合时, 二者会因模场 失配而造成较高的耦合损耗,这会大大影响EDWA的 实际应用,故需要对其进行再处理。若在制作波导的 玻璃表面与另一表面之间加适量电场时,由离子交换 形成的波导会向玻璃内部整体移动,从而形成折射率 极大值位于中心的对称分布掩埋型玻璃波导。这种 方法称为电场辅助热扩散型离子交换法(field assisted ion-exchanged, FAIE), 如图 3 所示。



2.2 热压粘结法

随着光通信的发展,光器件的集成需求越来越 高。人们开始探索在同一基片上同时制作有源和无 源器件。如下面将提到的合/分波集成光波导放大 器,需要在掺杂区对光信号进行放大,在非掺杂区对 光信号进行分/合。热压粘结法是一个很好的解决 方法^[4]。

粘结实质上是具有相近热膨胀系数的材料界面 润饰过程。润饰与粘附层的亲和力有关,亲和性越 大,粘附性越好。同类或相近化学键的物质相互粘 合,因而容易粘结。

2.3 溶胶 凝胶法

由于波导放大器有源区长度非常短,需要在有 源区重掺杂稀土离子。重掺杂带来了稀土离子聚集 的问题。目前可以通过掺锗/铝来避免离子聚集问 题。然而当前的光器件普遍采用光纤尾纤,因此,人 们希望放大器的基质材料也是硅玻璃,以提高集成 效率。前面提到的工艺方法都不能有效解决硅玻璃 中离子聚集问题。而溶胶凝胶法可以很好地解决 这一问题。同时溶胶凝胶法在制作低成本集成光 学和电子器件等方面有巨大的潜力。正是因为这些 特点,掺杂溶胶凝胶工艺受到了人们的重视。

溶胶 凝胶法的基本原理是:将金属醇盐或无机 盐经水解直接形成溶胶或经解凝形成溶胶(高分子 和微粒分散的胶体),然后使溶质聚合凝胶化,再将 凝胶干燥,焙烧,去除有机成分,最后得到无机材料。 用溶胶 凝胶法制备过程如下:选用适宜的基底材 料,浸入到配制好的溶胶中,利用物理或化学的作 用,在基底材料表面获得功能化的膜,重复此过程, 可获得多层膜,最后经过干燥、煅烧处理即可。图 4 是掺铒硅酸盐玻璃的溶胶的制备过程^[5]。

四乙基正硅酸盐异丙醇溶液



图 4 掺铒磷硅酸盐溶胶的制备过程

将合成的先体溶液在超净环境中甩膜,所用基 片为 Si 或 SiO₂。湿膜用甩胶机以 2000r/min 的旋转 速度获得,然后立即放入快速热处理炉内,热处理条 件为 400℃。重复以上过程,得到掺铒薄膜。经过 干燥处理后,用蚀刻法将薄膜制成条形波导,使用 PECVD 法(气相沉淀法)在条形波导表面沉淀十几



图 5 溶胶 凝胶法制备掺铒波导放大器

微米厚的硼磷硅酸盐玻璃(borophosphosilicate)覆层, 由此得到掩埋型波导。工艺流程如图 5 所示。

使用溶胶凝胶法制备光波导已有报道。而使用 凝胶溶胶法制备光波导放大器直到1999年才获得成 功。目前可在5cm长的有源区获得6dB增益^[6]。

3 新型结构的光波导放大器

3.1 弯曲光波导放大器

在发展高增益器件时,直波导放大器受材料本 身特性和集成要求的限制,增益难以做得更高。增 加有源波导长度,是提高波导放大器增益的有效途 径。然而,为了减少集成体积,波导长度一般限制在 5m~10cm。并且在制作平面集成光路(PLC)中,为 了整体布局,有源放大区有时候需要弯曲。为了解 决上述问题,人们提出了一种新型结构的光波导放 大器——弯曲波导放大器,如图6所示。



图 6 弯曲光波导放大器

这种结构可在有限的尺寸中大大增加有源波导 长度,从而提高增益,目前已有弯曲波导放大器成品 报道,其模块可以在 1535mm 波长窗口获得 27dB 的 增益,面积只有 79mm × 35mm 波导长度为47.7cm, 基质材料为硅酸盐玻璃。而目前最小的直波导放大 器模块可以在 1535mm 波长窗口获得 15dB 增益,其 面积为 130mm × 11mm。

在任何介质波导中,只要有弯曲就有辐射损耗, 而且弯曲光波导放大器中的抽运和信号光的横向场 在弯曲部分被破坏,两场的重叠因子发生改变。因 此必须考虑如何减少弯曲损耗。解决这一问题的有 效途径是分支补偿法(lateral offsets)^[7]。

结构优化的另一个任务是在尽量小的面积内, 有充分长的波导长度。当波导弯曲半径小于某一个 值时,传输损耗迅速增大。当波导弯曲半径 R =5mm 时,无源波导辐射损耗为 0. 0909dB/ cm。而R =4. 5mm 时,无源波导辐射损耗为 0. 3421dB/ cm。试 验结果表明,最佳的波导结构应包括直波导和螺旋 状的波导^[8],如图 7 所示。图 7b 是图 7a 的结构



图 7 a-结构未优化前的波导 b-结构优化后的波导 改进。在输入和输出部分,延长了直波导的长度。 最小弯曲半径也得到增大。利用线性法(method of line)对图形进行仿真,可以看到,优化后的波导增益 得到改善。如表 2 所示。可见,只使用直波导结构 无法在 11mm 的长度上实现如此高的增益。

表 2 优化前后弯曲波导增益特性比较

结构	最小半径	基片宽度	基片长度	基片面积	增益
	/ mm	/ mm	/mm	$/ \mathrm{mm}^2$	/dB
图 7a	3.69	15, 98	15.88	253.7	7.11
图 7b	5. 15	21. 59	11.39	146.0	9.28

3.2 合/分波集成波导放大器

这种放大器可以将单根光纤输入的信号放大, 分路后耦合到多路光纤输出,也可以将几路光信号 合路后再放大,然后输出到单根光纤。这种放大器 典型结构有1×4,1×8型合/分波集成波导放大器。 如图8所示。



图 8 合/分波集成光波导放大器

合/分波波导放大器是将两种不同功能的玻璃 器件粘合在一起制成的。有源放大区采用掺铒磷酸 盐玻璃,使光信号增益最大。无源部分采用不掺杂 的硅酸盐玻璃,使损耗最小。据报道,粘合损耗小于 0.3dB。目前这种放大器小信号增益可达10dB,噪 声指数小于5dB。小信号(-10dBm)无损带宽为 15mm,大信号(0dBm)无损带宽为6mm^[9]。

可以预见,随着工艺水平的发展,以后两种不同 功能的玻璃器件将可以在同一玻璃衬底上完成,这 样,可以大大减少波导之间的耦合损耗,同时提高器 件的稳定性。

3.3 锥形光波导放大器

锥形波导的锥形区长度为 2mm, 宽度从 6. 54m

渐变到 94m, 如图 9 所示。这种形状的波导放大器 可以提高波导和单模光纤的耦合效率。与此同时, 在波导内仍然可以保持信号与抽运光的单模传输, 抽运和信号的重叠因子基本保持不变。利用这种形 状的波导放大器, 可以在多方面得到广泛的应用。 比如与光纤、饱和布喇格反射器(SBR)构成 被动锁 模激光器。锁模激光脉冲宽度可达到飞秒量级^[10]。



图 9 锥形光波导放大器

3.4 EDWA 阵列

EDWA 本身的特点,使得 EDWA 可以作为平面 集成光路(PLC)的内部部件。美国 Implane 光子公司 在OFC2003 上宣布新的城域网 EDWA 放大器产 品^[11]。产品采用抽运光共享的方式,集成了 4 个 EDWA,每个放大器可以独立地控制光增益大小,在 9mm×25mm 大小的 PLC(平面光波回路)芯片上集 成了包括分路器、波分复用器、可变光衰减器、抽运, 光带阻滤波器及光监控抽头等 32 种功能光路。

如图 10 所示, 左图为 EDWA 阵列 PLC。4条信 号通道(右图中的 1)均包含有光输入和输出分流 器,每个分流器由一个独立的 PIN 信道监测器(右图 中的 2)终结。抽运分配网络(右图中的 3)由一个抽 运混合器和 4 个独立的可变光衰减器(VOA)组成。 该网络与一个或两个 980mm 抽运激光器相连接。



图 10 EDWA 阵列 PLC

采用抽运分配网络使得几个放大器同时使用一 个抽运激光器,这样可降低单个放大器的成本。 VOA 可以用来控制抽运激光器发射的抽运能量以 及最终耦合到每一个掺铒波导中的抽运能量。抽运 光通过 VOA 后,由4 个粗波分复用耦合器和信号光 耦合在仪器,之后抽运光和信号光通过4 个掺铒波 导,信号光得到放大。

EDWA阵列可应用于包括于接收机、发射机以

及线路放大器内。这些应用适用于不同的网络,如 10Gbit/s 城域网、城域核心网、未来的40Gbit/s 城域 网。EDWA 阵列的其它应用包括光分插复用器的信 道均衡,波分复用器和解复用器的前置和后置功率 放大,以及交换矩阵的损耗补偿等等。

4 未来光波导放大器研究内容和主要发展 方向

未来光波导放大器的设计与创新将比原来的研 制更为严格。一方面,为了满足信息量的传输,光波 导放大器需要更宽的带宽来实现多信道的光放大, 更高的功率放大来实现超常距离的信号传输,因此, 单位长度高增益、宽带宽材料的进一步研究成为重 点。另外一个方面,由于工程的需要,光波导放大器 的设计将向集成化器件方面发展。新的集成光学工 艺的探索和研究也将继续进行。

参考文献

[1] 张 龙,林凤英,祈长鸿 et al.用于1.5¹m光波导放大器的高浓度 Er³⁺ 掺杂玻璃[J].光学学报, 2000, 20(12): 6165~6173.

[2] SIKORSKI Y, SAID A A, BADO P et al. Optical waveguide amplifier

- fin Nd doped glass written with near IR femtosecond laser pulses [J]. Electron Lett, 2000, 36: 226~227.
- [3] ANTONELLA D O, de MARCO S, LUCIANO M et al. Design of praseodymium doped optical waveguides [J]. Opt Engng, 2003, 42: 765 ~ 772.
- [4] GRAF J, SAUTTER H, MUELLER FIEDLER R. Erbium doped waveguide amplifier in glass fabricated by a hot pressing technology [A]. Confrence on Lasers and Electro Optics Europe Technical Digest [C]. New York: IEEE Lasers and Electro Optics Society, 1998. 263.
- [5] HUANG W, SYMS R R A, YEATMAN E M *et al.* Fiber-device fiber gain from a sol gel erbium amplifier [J]. IEEE Photon Technol, 2003, 14: 959~961.
- [6] HUANG W, SYMS R R A. Sol gel silicar orr silion buried channel ED-WAS [J]. J Lightwave Technol, 2003, 21:1339~ 1349.
- [7] KITOH T, HUANG Y T. Bending loss reduction in silicar based waveg uides by using lateral offset [J]. J Lightwave Technol, 1995, 13: 555~ 562.
- [8] LOWE D, SYMS R R A, HUANG W B. Layout optimization for Erbium doped waveguide amplifiers [J]. J Lightwave Technol, 2002, 20:454~ 462.
- [9] JAOUEN Y, du LAURENT M, DENIS B et al. Eight wavelength Er-Yb doped amplifier combiner/splitter planar integrated module [J]. IEEE Technol Lett, 1999, 11: 1105~ 1107.
- [10] ROTH J M, BERGMAN K, BARBIER D et al. Passive harmonically modelocked fiber laser using a tapered Er/Yb waveguide amplifier and a saturable Bragg reflector [A]. IEEE Nonlinear Opt Mater Fundam Appl Conf Proc [C]. New York: IEEE, 2000. 313~ 315.
- [11] FROLOV S V, SHEN T M, BRUCE A J. EDWA: key enabler of optical integration on PLC [J]. SPIE, 2003, 4990:47~ 54.